

実験と数値計算による高温水中ステンレス 鋼すき間内導電率と電位の関係の研究

国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 原子力基礎工学研究センター 相馬康孝

未来へげんき

To the Future / JAEA

日本原子力学会「水化学部会」

第49回定例研究会 大阪

2024.11.28





◆研究の背景:なぜ「すき間」、「導電率」か ◆実験結果について ◆数値計算について(簡易的に説明) ◆おわりに







研究背景

■研究背景はステンレス鋼の応力腐食割れ (SCC). のメカニズム関連の研究.

- ■弊所(JAEA、原子力基礎工学研究センター)は 沸騰水型軽水炉(BWR)環境用の水循環装置の み保有.
- □講演者はBWR環境における応力腐食割れ (SCC) 挙動に及ぼす環境因子に着目した研究を 2011年頃から開始。

□すき間(クレビス)も環境因子の一つとして認識.

■実機調査事例がSCCとすき間効果を認識した第一 歩.



実機事例調査報告書





- 1. JAERI-Tech 2004-002
- 2. JAERI-Tech 2004-004
- 3. JAERI-Tech 2004-011
- 4. JAERI-Tech 2004-012
- 5. JAERI-Tech 2004-015
- 6. JAERI-Tech 2004-049
- 7. JAERI-Tech 2004-003

「JOPSS」により入手可能

To the Future / JAEA



蒸気乾燥

ジェットポン プ

約50mm

|約200mm

。 約40mm

原子炉圧力容器(1号機)概略図

H1溶接線

約30mm

H2溶接線

上部胴周辺詳細

义

·JIS G 4304、SUS 304L(圧延材) (0.010%C, 18.32%Cr, 10.05%Ni) 使用条件 (原子炉定格運転時):

·炉水溶存酸素濃度:150~250ppb

·中性子照射量:約1.4×10²³n/m²(E>1MeV)

・炉水導電率:約15µS/m以下

·運転開始日:1984年6月1日 ·定格負荷相当年数(EFPY):14.55年

1. 目的

気水分离 뿖

炉心

上部リング

(SUS304L

上部胴·

SUS304L

中間部リン

(SUS304L)

中間部胴

(SUS304L)

シュラウド材料:

運転開始時期:

·温度:約 286℃ •運転圧力:約6.9MPa

ウド

実機事例調査報告書

東北電力(株)女川原子力発電所1号機のシュラウドひび割れ部(O1-H2)に関する調査の概要(1/4)

外径 約4.0m

外表面側

H3溶接部

中間部胴

破面観察

ボートサンプル

採取位置

中間部リン

金相観察・硬さ試験

H2溶接部詳細

<u>5</u>mm

2. 調査内容 ひび割れ(以下、き裂)が検出されたシュラウド中間部リング外表面から採 (1) 外観観察 目視観察及び写真撮影(表面状態・き裂部の調査) 取したサンプルの各種検査を実施し、き裂発生の原因究明に資する. (2)金相観察 金属組織の光学顕微鏡観察(き裂形態の調査) (3)破面観察 き裂部破面の走査型電子顕微鏡(SEM)観察(き裂形態の調査) (4)ビッカース硬さの測定(加工及び溶接の影響の調査) 硬さ試験 (5) 試料分析 結晶粒界近傍のFE-TEM¹⁾による化学成分分析、EPMA²組成分析 1)FE-TEM:電界放射型透過型電子顕微鏡 2)EPMA:電子プローブマイクロアナライザー 中間部リング 3. 調查結果(1) 外観観察 外表面側 溶接線側 ለ ለ ለ 約7.3m 3.9 き裂A 18.3m 8.5 き 裂 B シュラウド き裂C 31.54 内表面側 上部胴 H2溶接部 45.5m 10mm m き裂A き裂B 1mm き裂C 金相観察・硬さ試験・ 化学成分分析 粒界分析 き裂A先端 0.2mm 0.2mm 0.2mm 図2 調査サンプルの外観、き裂の状況 まとめ:・サンプル表面上で溶接線側から20mm以内の領域に3本のき裂を確認した。 ・サンプル表面上で機械加工による縞模様が幅約1mm間隔で確認された. 未来へれた 図1 調査サンプルの採取位置及びサンプル調査方法

平成15年2月5日

日本原子力研究所



実機事例調査報告書

東北電力(株)女川原子力発電所1号機のシュラウドひび割れ部(O1-H2)に関する調査の概要(2/4) ^{平成15年2月5日}





実機SCC内部の腐食



き裂内部において、バルクでは見られない局部的腐食が発生 →クレビス効果により腐食環境がバルクより厳しい可能性

To the Future / JAE



クレビス環境の研究

- □高温・高純度水中であっても 腐食は起きる.原因はおそら くすきま腐食(1955).
- □クレビスはSCC発生を加速す るし、いずれにせよ一度ク ラックが発生したらそれはク レビスである(1973).
 - ■米GEのグループを中心とした研究. 日本においても先駆的な研究例 (1970後半~90).
 - 軽水炉環境におけるすき間水化学 (Crevice Water Chemistry: CWC)の レビュー(2002).

□ 2000年代に入り研究は比較的低調.





Pertti Aaltonen, Martin Bojinov, Mika Helin, Petri Kinnunen, Timo Laitinen, Erkki Muttilainen, Kari Mäkelä, Anneli Reinvall, Timo Saario & Aki Toivonen

Facts and views on the role of anionic impurities, crack tip chemistry and oxide films in environmentally assisted cracking





酸素濃淡電池による電位差でイオンを濃縮 = "腐食反応(ΔG<0)"を駆動力とした"イオンポンプ"



すき間腐食試験





すき間腐食試験

使用装置:SUS316ステンレス鋼製オートクレーブを備えた高 温水循環装置 温度:288℃, 圧力:8 MPa, 容量:1.8 L、流速:約5 L/h 導電率:0.06~0.09 μS/cm, 濃度:約32ppm(純酸素飽和) 存酸素 (**DO**)



11

未来へげんき













2種類の局部腐食について断面TEM分析







■事前に特定した介在物の位置と円形腐食発 生位置が一致 ■円形腐食部は、S含有介在物を起点とした 局部腐食

S

Ca













(画像処理により上下反転)

□円形腐食は対称的分布 □ 溶解した介在物は腐食雰囲気を形成 To the Future / JAEA

未来へげんき



局部腐食の分布(1)



□ すき間内でアノード(三日月型)とカソードが マクロ的に分離している可能性 To the Future / JAEA

未来へげんき







時間、すき間の幾何学形状、環境のバランスにより、局部腐食は様々な 分布形態をとる.クラッドの下がすき間になるともいわれる.



小括および本研究の目的

- □ 溶存酸素を含む高温高純度水中(BWR環境)におけるス テンレス鋼には腐食性の雰囲気(CWC)が形成.
- □ CWC自体は欧米の研究者を中心に過去に活発な研究がな され、詳細は良く知られている.
- □ 実機BWRSCCでもCWCは無視できない可能性.
- ■各種の計測結果(イオンサンプリング、pH、電位)結果 は報告されている.
- □一方、<u>その場(In-situ)測定、空間分解能</u>を多少でも示す データは比較的少ない.⇒これらを知りたい.
- □比較的簡易に測定できる導電率に着目し、測定技術開発.
- □取得された導電率を活かし、今後より長期あるいは多様 なすき間構造に対応するにはモデル計算が必要.











電気化学インピーダンス法により導電率を算出











SUS316Lすき間の導電率変化(初期)



Figure 6 Crevice surface after 100 h immersion in 288°C pure water with DO concentration of 32 ppm. (a)~(c) optical images, (d) Backscattered electron image.





局部腐食発生時のすき間内環境の推定

入力情報 FeCr₂O₄ □すき間内酸化物の熱力学平衡 Fe₃O₄ □288°C水の解離平衡、電荷中性 □各イオンのモル伝導度の和=実測値 (および、いくつかの仮定) 連立方程式の解 各イオンの濃度[mol/kg] *E*(電位V) pН $C_{\rm Fe^{2+}}$ $C_{\rm Ni^{2+}}$ $C_{\rm OH}$ - $C_{\rm Cr(OH)^{2+}}$ $C_{\rm HSO_4^-}$ 10-3.03 10-6.03 $10^{-2.69}$ $10^{-7.59}$ 3.71 10^{-7} -0.271(Fixed) pHは288℃における中性値(≈5.6)から酸性化 この程度でもL材は十分危険領域 未来へげんき To the Future / JAEA

(AF導電率と電位の関係(局部腐食非発生すき間)



25









すき間内部の模式図



$$\frac{C_{\rm in}}{C_{\rm out}} = \exp(-zF\Delta\emptyset/RT)$$

希薄溶液中の(非反応性)アニオン濃縮は上式で与えられる.





すき間内の電位





おわりに

- 1. BWR相当環境においては、すき間構造内部に腐食性の高い環境(crevice water chemistry)が形成される.
- 2. すき間内溶液導電率の測定技術を開発し、様々な腐食状況における数値を測定. すき間内の導電率はバルクよりも大幅に(100倍程度)高くなる.
- 3. すき間内導電率は電位との複雑な関係になる. すき間内 導電率からpHやCl-イオン濃度等より具体的な情報得るた めには、モデル計算とそれに入力する確度の高い実験 データが必要.